

ICS 31.030  
L 97



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15871—1995

---

## 硬面光掩模基板

Hard surface photomask substrates

1995-12-22 发布

1996-08-01 实施

---

国家技术监督局 发布

## 前 言

本标准非等效采用 SEMI 标准 Semi P1—92《硬面光掩模基板》。

本标准基板技术要求全部按 Semi P1—92 中第 4 章至第 8 章制定。

本标准附录 A 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由电子工业部标准化研究所归口。

本标准起草单位：长沙韶光微电子总公司、电子工业部标准化研究所。

本标准主要起草人：吴保华、王亦林、赵雨生、谈仁良。

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15871—1995

## 硬面光掩模基板

Hard surface photomask substrates

### 1 范围

本标准规定了硬面光掩模用玻璃基板的要求、试验方法、检验规则等内容。  
本标准适用于硬面光掩模用玻璃基板(以下简称基板)。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 191—90 包装储运图示标志
- GB 2828—87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829—87 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB 3102.3—93 力学的量和单位
- GB 7238—87 玻璃及铬板表面平整度的测试方法
- GB 9622.2—88 电子玻璃平均线热膨胀系数的测试方法
- SJ/T 10584—94 微电子学光掩蔽技术术语

### 3 定义

本标准采用 SJ/T 10584 规定的定义。

### 4 要求

#### 4.1 外形尺寸

4.1.1 方形基板的外形尺寸应符合表 1 和图 1 的规定。

表 1 方形基板的外形尺寸

mm

规格	边长(L)		垂直度	厚度(T)	
	min	max		min	max
63.5×63.5	62.70	63.50	0.05/25.40	1.40	1.60
76×76	75.40	76.20	0.05/25.40	1.40	1.60
88.9×88.9	88.10	88.90	0.05/25.40	1.40	1.60
100×100	100.80	101.60	0.05/25.40	1.40	1.60
				2.20	2.40

国家技术监督局 1995-12-22 批准

1996-08-01 实施